Family list
21 family members for:
JP52030899
Derived from 16 applications.

- 1 No English title available Publication info: AU497066 B2 - 1978-11-23
- 2 PHOTOCOPOLYMERIZABLE COMPOSITIONS BASED ON EPOXY AND HYDROXYLCONTAINING ORGANIC MATERIALS
  Publication Info: AU1735976 A 1978-03-09
- 3 Photocopolymerizable compositions based on epoxy and hydroxylcontaining organic materials Publication info: BE845746 A1 - 1977-03-01
- 4 Photocopolymerizable compositions based on epoxy and hydroxylcontaining organic materials Publication info: BR7605796 A - 1977-08-16
- 5 PHOTOPOLYMERIZABLE COMPOSITIONS CONTAINING EPOXY AND HYDROXYL-CONTAINING ORGANIC MATERIALS AND AROMATIC IODONIUM OR SULFONIUM SALT PHOTO INITIATORS
  Publication info: CA1114089 A1 1981-12-08
- 6 Photocopolymerizable compositions based on epoxy and hydroxylcontaining organic materials Publication info: CH630655 A5 - 1982-06-30
- 7. Photocopolymerizable compositions based on epoxy and hydroxyl-containing organic materials
  Publication info: DE2639395 A1 1977-03-10
  DE2639395 C2 1991-03-14
- 8 Photocopolymerizable compositions based on epoxy and hydroxylcontaining organic materials Publication Info: FR2322897 A1 - 1977-04-01 FR2322897 B1 - 1982-01-29
- 9 PHOTOCOPOLYMERIZABLE COMPOSITIONS BASED ON EPOXY AND HYDROXYL-CONTAINING ORGANIC MATERIALS
  Publication info: GB1565671 A 1980-04-23
- 10 Photocopolymerizable compositions based on epoxy and hydroxylcontaining organic materials
  Publication Info: IT1066298 B 1985-03-04
- 11 PHOTOOCOPOLYMERIZABLE COMPOSITE CONSISTING OF EPOXY AND HYDROXYL RADICALLCONTAINING ORGANIC SUBSTANCE

Publication info: JP1266325C C - 1985-05-27
\*JP520308997A - 1977-03-08
\*JP59042688B B - 1984-10-17

12 Photocopolymerizable compositions based on epoxy and hydroxylcontaining organic materials

Publication info: SF427277 B - 1983-03-21

Publication info: SE427277 B - 1983-03-21 SE427277 C - 1985-03-17

- 13 Photocopolymerizable compositions based on epoxy and hydroxylcontaining organic materials Publication Info: SE7609584 A - 1977-03-03
- 14 Photocopolymerizable compositions based on epoxy and hydroxylcontaining organic materials Publication info: US4256828 A - 1981-03-17
- 15 Process of using photocopolymerizable compositions based on epoxy and hydroxyl-containing organic materials
  Publication Info: US4318766 A 1982-03-09
- 16 PHOTOCOPOLYMERIZABLE COMPOSITIONS BASED ON EPOXY AND HYDROXYL CONTAINING ORGANIC MATERIALS
  Publication info: ZA7605241 A 1977-08-31

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# PHOTOOCOPOLYMERIZABLE COMPOSITE CONSISTING OF EPOXY AND HYDROXYL RADICALLCONTAINING ORGANIC SUBSTANCE

Patent number:

JP52030899

**Publication date:** 

1977-03-08

Inventor:

JIYOOJI HENRII SUMISU MINNESOTA MINING & MFG

Applicant: Classification:

- international:

C08G59/62; C08G59/68; G03F7/038; C08G59/00;

G03F7/038; (IPC1-7): C08G59/68; C08K5/00

- european:

C08G59/62; C08G59/68; G03F7/038N

Application number: JP19760103780 19760901 Priority number(s): US19750609898 19750902 Also published as:

US4256828 (A1)
GB1565671 (A)
FR2322897 (A1)
DE2639395 (A1)

CH630655 (A5)

more >>

Report a data error here

Abstract not available for JP52030899

Abstract of corresponding document: US4256828

Photocopolymerizable compositions are described which contain epoxides, organic material with hydroxyl functionality, and a photosensitive aromatic sulfonium or iodonium salt of a halogen-containing complex ion. Coated substrates are also described.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# (19) 日本国特許庁(JP) (11) 特許出願公告

# ⑫特 許 公 報(B2) 昭59-42688

⑤Int.Cl.<sup>3</sup>
C 08 G 59/68
59/66
C 09 D 3/58
C 09 J 3/16

庁内整理番号 6958-4 J 6958-4 J 6516-4 J 7102-4 J 2000公告 昭和59年(1984)10月17日

発明の数 1

(全18頁)

1

識別記号

図エポキシ及びヒドロキシル含有有機物質に基づく 光共重合可能組成物

20特

願 昭51—103780

22)出

願 昭51(1976)9月1日

69公

開 昭52-30899

- ④昭52(1977) 3月8日

優先権主張 ②1975年9月2日③米国(US)③ 609898

⑦発 明 者 ジョージ・ヘンリー・スミス アメリカ合衆国ミネソタ州セント ポール・メープルウツド・ハドソ ン・ロード2501番

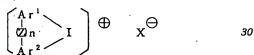
⑦出 願 人 ミネソタ・マイニング・アンド・マニユフアクチュアリング・コン 15 パニー

アメリカ合衆国ミネソタ州セント ポール・メープルウツド・ハドソ ン・ロード2501番

個代 理 人 弁理士 浅村 皓 外3名 20

#### 57特許請求の範囲

- 1 (a) 約1.5 より大きいエポキシド官能性を有する第1有機物質;
- (b) 少くとも1のヒドロキシル官能性を有する第 25 2有機物質;及び
- (c) ホト開始剤が
  - (i) 式



(式中Ar<sup>1</sup>とAr<sup>2</sup>は4ないし20炭素原子を有する芳香族基でありかつフェニル、チェニル、フラニル及びピラブリル基からなる群から選択され: Zは酸素: イオウ; S=0; 35 C=0; O=S=0; R-N(ここでRはアールスはアシルである); 炭素対炭素結合; 又はR<sub>1</sub> - C-R<sub>2</sub> (ことでR<sub>1</sub>とR<sub>2</sub>は水素、1ないし4炭素のアルキル基、及び2ないし4炭素のアルケニル基から選択される);からなる群から選択され、そしてnはゼロ又は1であり; X<sup>-</sup>はテトラフルオロボレート、ヘキサフルオロホスフエート、ヘキサフルオロアルセネート、及びヘキサフルオロアンチモネートから選択されたハロゲン含有錯陰イオンである〕を有する芳香族ヨードニウム錯におよび

2

(ii) 式

10

(R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>及びR<sub>3</sub>は4ないし20炭素原 子を有する芳香族基及び1ないし20炭素原 子を有するアルキル基からなる群から選択さ れ;しかも R<sub>1</sub>,R<sub>2</sub>及び R<sub>3</sub>の少くとも一つは 芳香族であり;乙は酸素;イオウ;S=O;  $= 0 : 0 = \dot{S} = 0 : R - \dot{N} (CC\dot{C}RdC)$ -ル又はアシルである);炭素対炭素結合; 又は $R_4 - C - R_5$ (ここで $R_4 \ge R_5$ は水素、 1ないし4炭素原子を有するアルキル基及び 2ないし4炭素原子を有するアルケニル基か らなる群から選択される);からなる群から 選択され;そしてnはゼロ又は1であり;X はテトラフルオロボレート、ヘキサフルオロ ホスフェート、ヘキサフルオロアルセネート、 及びヘキサフルオロアンチモネートから選択 されたハロゲン含有錯陰イオンである〕を有 する芳香族スルホニウム錯塩、

からなる群から選択された錯塩ホト開始剤であることを特徴とする開始剤、

を含むことを特徴とする重合可能な組成物。

2 第2有機物質(b)が少くとも2のヒドロキシル 官能性を有することを特徴とする特許請求の範囲 第1項に記載の重合可能な組成物。

発明の詳細な説明

本発明は光重合可能な組成物に関するものであ る。更に特に本発明はエポキシド官能性を有する 有機物質及びヒドロキシル官能性を有する他の有 機物質を含む組成物に関するものである。この組 成物は更にホト開始剤として芳香族スルホニウム 又はヨードニウム錯塩を含み、そして活性輻射線 又は電子ビーム照射へ露出により硬化される。

本発明に従つて活性輻射線又は電子ビーム照射 へ露出により容易に光硬化される光共重合可能な 10 組成物が供される。この組成物は下記のものを含 tr:

- (a) 約1.5より大きいエポキシド官能性を有する 第1有機物質;
- (b) 少くとも1のヒドロキシル官能性を有する第 2有機物質;及び
- (c) 芳香族ヨードニウム錯塩及び芳香族スルホニ ウム錯塩からなる群から選択された錯塩ホト開 始剤。選択的に、そして好ましくは、この組成 物はホト開始剤のための増感剤を含む。

本発明の光共重合可能な組成物は従来公知の組 成物の欠点に打勝つ。例えば、本発明の組成物は 優れた貯蔵寿命を有するワンパートの(one-part) 安定な組成物であり、そして室温又はそれ以下で さえ光重合可能である。組成物中のエポキシドの 25 当量の数がヒドロキシル含有物質の当量より大き い時には、硬化した組成物は優れたタフネス;耐 摩耗性;金属、ガラス、プラスチツク、木材及び 他の表面への接着性及び化学的攻撃に対する耐性 を有する。このエポキシドが組成物の比較的少量 のフラクションを構成し、そしてヒドロキシル含 有物質が多官能性である時には、生成する硬化し た組成物の特性は主としてヒドロキシル含有物質 の特性に依存する。また、液体ヒドロキシル含有 有機物質は液体エポキシドと結合されて低粘度と 優れた熱安定性の無溶媒被覆を供する;しかもと の組成物は揮発物の放出なしに、急速に光硬化さ れて他の望ましい性質を損失することなく丈夫な、 可撓性被覆を供する。更に、無溶媒液体組成物を が排除され、そしてエネルギー消費と汚染が最小 にされる。本発明の組成物は種々の適用、例えば 光硬化可能なインキビヒクル、研摩粒子のための 結合剤、塗料、接着剤、リトグラフイーとレリー

フ印刷版面のためのコーテイング、金属、木材等 のための保護コーテイングに使用できる。

エポキシドのための共単量体として適当なヒド ロキシル含有有機物質の選択により、光又は電子 ビームへ露出により容易に硬化されて所望の物理 的性質を有する硬化した組成物を供する、貯蔵安 定性、ワンパートの光硬化可能組成物が容易に得 られる。

本発明の組成物に有用なエポキシ含有物質は環 開裂により重合可能なオキシラン環(即ち、

- C - C - )を有する任意の有機化合物である。 広くエポキシドと称されるこの物質は単量体エポ キシ化合物及び重合体型のエポキシドを含み、そ して脂肪族、脂環式、芳香族又は複素環式である。 15 これらの物質は一般に平均して分子当り少くとも 1.5 の重合可能なエポキシ基(好ましくは分子当 り2つ又はそれ以上のエポキシ基)を有する。重 合体エポキシドは末端エポキシ基を有する線状重 合体(例えばポリオキシアルキレングリコールの 20 ジグリシジルエーテル)、スケルタル(skeltal) オキシラン単位を有する重合体(例えばポリブタ ジエンポリエポキシド)、及びペンデントエポキ シ基を有する重合体(例えばグリンジルメタクリ レート重合体又は共重合体)を含む。このエポキ シドは純粋な化合物であるが、一般に分子当り一 つ、二つ又はそれ以上のエポキシ基を含有する混 合物である。分子当りエポキシ基の " 平均の " 数 は存在するエポキシ分子の総数でエポキシ含有物 質中のエポキシ基の総数を割ることにより決めら 30 れる。

これらのエポキシ含有物質は低分子量単量体物 質ないし高分子量重合体と異なり、そしてそのバ ツクボーンと置換基の性質で非常に異なる。例え は、バツクボーンは任意の型式でよくかつその置 35 換基は室温でオキシラン環と反応性である活性水 素原子を含まない任意の基でよい。許容し得る置 換基の例はハロゲン、エステル基、エーテル、ス ルホネート基、シロキサン基、ニトロ基、ホスフ エート基等を含む。エポキシ含有物質の分子量は 使用する時には、溶媒被覆に関連した問題と欠点 40 58ないし約100,000又はそれ以上と異なる。 種々のエポキシ含有物質の混合物がまた本発明の 組成物に使用できる。

> 有用なエポキシ含有物質はエポキシシクロヘキ サンカルボキシレートのようなシクロヘキセンオ

キシド基を含有するものを含み、3,4-エポキ シシクロヘキシルメチルー3,4ーエポキシシク ロヘキサンカルボキシレート、3,4-エポキシ -2-メチルーシクロヘキシルメチルー3,4-エポキシー2ーメチルシクロヘキサンカルボキシ 5 レート、及びビス(3,4-エポキシー6-メチ ルシクロヘキシルメチル) アジペートにより例示 される。この性質の有用なエポキシドの更に詳細 なリストについて、米国特許 163,117,099が 参照される。

本発明の実施に特に有用である別のエポキシ含 有物質は式:

$$R'(OCH_2-CH-CH_2)n$$

(式中間はアルキル又はアリールであり、そし 15 ルジグリシジルエーテルを含む。 てnは1ないし6の整数である)のグリシジルエ ーテル単量体を含む。多価フエノールと過剰のク ロロヒドリン、例えばエピクロロヒドリンを反応 させることによつて得られた多価フェノールのグ リシジルエーテル(例えば、2,2ーピスー(2,20 3-エポキシプロポキシフエノール)プロパンの ジグリシジルエーテル)がその例である。本発明 の実施に使用できるこの型式のエポキシドの別の 例は米国特許 M 3,0 1 8,2 6 2 及びリー(Lee) 及びネビル (Neville) による "Handbook of Epoxy Resins "マグローヒルブツクス社、ニュ ーヨーク(1967)に記載される。

本発明に使用できる多くの市販のエポキシ含有 物質がある。特に、容易に利用し得るエポキシド はオクタデシレンオキシド、エピクロロヒドリン、30 例えばエチルグリシデートを含む。 スチレンオキシド、ビニルシクロヘキセンオキシ ド、グリシドール、グリシジルメタクリレート、 ビスフェノールAのジグリシジルエーテル (例え ばシエルケミカル社からの『エポン(Epon) 828"、"エポン1004"、及び"エポン ′ 35 は他の"活性水素"を含まない。用語の"活性水 1010"、ダウケミカル社から"DER-331 "、 "DER-332"、及びDER-334 "の商品名で市販されるもの)、ビニルシ クロヘキセンジオキシド(例えばユニオンカーバ イド社からの "ERL-4206" (商品名)、 3,4-エポキシシクロヘキシルメチルー3,4 ーエポキシシクロヘキセンカルボキシレート(例 えば、ユニオンカーパイド社からの『ERL-4221"(商品分)、3,4-エポキシー6-

15 .

メチルシクロヘキシルメチルー3,4一エポキシ -6-メチルシクロヘキセンカルボキシレート ( 例えば、ユニオンカーバイド社からの " E R L - 4201 "(商品名)、ビス(3,4-エポキ シー6ーメチルシクロヘキシルメチル)アジペー ト、ビス(2,5-エポキシーシクロペンチル) エーテル、ポリポロピレングリコールで変性され た脂肪族エポキシ、ジペンテンジオキシド、エポ キシ化ポリブタジエン、エポキシ官能性を含有す 10 るシリコーン樹脂、難燃性エポキシ樹脂、フエノ ールーホルムアルデヒドノボラツクの1,4ープ タンジオールジグリシジルエーテル〔例えば、ダ ウケミカル社からの"DEN-431"及び "DEN-438"(商品名)) 及びレグレンノー

なお他のエポキシ含有物質は一つ又はそれ以上 の共重合可能なビニル化合物とグリシジルアクリ レート及びグリシジルメタクリレートのようなグ リシドールのアクリル酸エステルの共重合体であ る。この共重合体の例は1:1スチレングリシジ ルメタクリレート、1:1メチルメタクリレート ーグリシジルアクリレート及び62.5:24: 13.5メチルメタクリレートーエチルアクリレー トーグリシジルメタクリレートである。

他の有用なエポキシ含有物質は周知であり、そ してエピクロロヒドリンのようなエポキシド、例 えばエピクロロヒドリン:アルキレンオキシド、 例えばプロピレンオキシド; アルケニルオキシド、 例えばプタジェンオキシド;グリシジルエステル、

本発明に使用されるヒドロキシル含有物質は少 くとも1の、そして好ましくは少くとも2のヒド ロキシル官能性を有する任意の液体又は固体の有 機物質でよい。また、ヒドロキシル含有有機物質 素 " は周知でありそして通常当業界で使用され、 かつここで使用される時これはツェレビチノフ (Zerewitinoff)によるJ.Am. Chem. Soc. 第 49巻、3181(1927)に記載される方法 40 により決定される活性水素を意味する。勿論、ヒ ドロキシル含有物質はまた熱的又は光分解的に不 安定である基を実質上含まない;即ち、この物質 は約100℃以下の温度で、又は光共重合可能組 成物に対して所望の硬化条件の間に出会う活性光

又は電子ビーム照射の存在で分解せず、又は揮発 性成分を放出しない。

好ましくはこの有機物質は二つ又はそれ以上の第一又は第二脂肪族水酸基を含む(即ち、この水酸基は非芳香族炭素原子に直接結合される)。この水酸基は末端に配置され、又はこれらは重合体又は共重合体からぶら下つている。(pendent)ヒドロキシル含有有機物質の分子量(即ち数平均分子量)は非常に低い(例えば62)ものから非常に高いもの(例えば百万又はそれ以上)で異なる。ヒドロキシル含有物質の当量(即ち、数平均当量)は好ましくは約31ないし5000の範囲内である。より高い当量の物質が使用される時には、これらは共重合の速度と程度を減ずる傾向を示す。

1のヒドロキシル官能性を有する好適な有機物質の代表例はアルカノール、ポリオキシアルキレングリコールのモノアルキルエーテル、アルキレングリコールのモノアルキルグリコールエーテル及び当業者に公知の他のものを含む。

有用な単量体ポリヒドロキシ有機物質はアルキレングリコール(例えば、1,2ーエタンジオール、1,3ープロパンジオール、1,4ーブタンジオール、2ーエチルー1,6ーへキサンジオール、ピス(ヒドロキシメチル)シクロへキサン、251,18ージヒドロキシオクタデカン、3ークロロー1,2ープロパンジオール)、ポリヒドロキシアルカン(例えば、グリセリン、トリメチロールエタン、ペンタエリスリトール、ソルビトール及び他のポリヒドロキシ化合物、例えばN,Nー30ビス(ヒドロキシエチル)ベンズアミド、2ープチンー1,4ージオール、4,4′ービス(ヒドロキシメチル)ジフエニルスルホン、ひまし油等を含む。

有用な重合体ヒドロキシ含有物質の代表例はポ 35 リオキシエチレン、及びジオールに対して100 ないし5000の、又はトリオールに対して70 ないし3300の当量に対応する、約200ないし約10,000の分子量のポリオキシプロピレングリコールとトリオール;種々の分子量のポリテ 40トラメチレングリコール;他の遊離基重合可能な単量体、例えばアクリレートエステル、ハロゲン化ビニル又はスチレンとヒドロキシプロピルとヒドロキシエチルアクリレート及びメタクリレート

8 の共重合体;ビニルアセテート共重合体の加水分 解又は一部加水分解によつて形成されたペンデン ト水酸基を含有する共重合体、ペンデント水酸基 を含有するポリビニルアセタール樹脂;ヒドロキ シエチル化及びヒドロキシプロピル化セルロース のような変性セルロース重合体;ヒドロキシ末端 化ポリエステル及びヒドロキシ末端化ポリラクト ン及びヒドロキシ末端化ポリアルカジンを含む。 有用な市販のヒドロキシル含有物質はポリテト ラメチレンエーテルグリコールの"ポリメグ (polymeg) "(商品名)シリーズ(クエーカー オーツ社から市販)、例えば"ポリメグ"(商品 名)650、1000及び2000;第二水酸基 を有するポリオキシアルキレンテトロールの『ペ 15 プ(Pep)(商品名)シリーズ、例えばペプ"(商 品名) 450、550及び650;ポリビニルア セタール樹脂の " ブチバール (Butvar ) " (商品 名)シリーズ(モンサントケミカル社から市販)、 例えば " プチバール " ( 商品名 ) B - 7 2 A 、 B 20 -73、B-76、B-90及びB-98; "フ オームバー(Formvar) "(商品名)7/70、 12/85, 7/95S, 7/95E, 15/ 95 S及び15/95 E;ポリカプロラクトンポ リオールの" PCP" (商品名)シリーズ(ユニ 25 オンカーバイドから市販)、例えば"PCP" (商品名)0200、0210、0230、 0240、0300;脂肪族ポリエステルジオー ルの "パラプレツクス (Paraplex) U-1 4 8 " (商品名)(ロームアンドハスから市販);飽和

ポリエステルポリオールの"マルトロン(Multron)" R(商品名)シリーズ(モーベイケミカル社から市販)、例えば"マルトロン"(商品名)R-2、R-12A、R-16、R-18、R-38、R-68、及びR-74;約100の当量を有するヒドロキシプロピル化セルロースの"クルセル(Klucal)E"(商品名)(ハーキュレス社から市販);及び約400のヒドロキシル当量を有するセルロースアセテートブチレートエステルの"アルコールソリユーブルブチレート(Alcohol Soluble Butyrate)"(商品名)(イーストマンコダツクから市販)を含む。

本発明の組成物に使用されるヒドロキシル含有 有機物質の量はエポキシドとこのヒドロキシル含 有物質の相溶性、ヒドロキシル含有物質の当量と 官能性、最終硬化組成物に所望される物理的性質、 光硬化の所望される速度等の要因に応じて、広い 範囲にわたつて異なる。

概して言えば、組成物中のヒドロキシル含有物 質の増加する量と共に、硬化生成物は改良された 5 衝撃抵抗、基質への接着、可撓性及び硬化中減少 した収縮を示し、そして対応して硬度、引張強さ 及び耐溶剤性に徐々の減少がある。

単官能性及びポリ官能性ヒドロキシル含有物質 の両方は本発明の組成物に所望の結果を供するけ 10 れども、ポリ官能性ヒドロキシル含有物質の使用 が多くの適用に対して極めて好ましいが、単官能 性ヒドロキシル含有物質が低粘度、溶剤を含まな い被覆組成物を供するのに特に有効である。明ら するヒドロキシル含有有機物質を使用する時には、 エポキシの当量当り約0.2より大きい当量のヒド ロキシルが一般に内部強度と引張強さにおいて低 くそして溶剤攻撃を受け易く、結果的に多くの適 を示す。この傾向はヒドロキシル含有物質の増加 する当量と共に益々より明白になる。従つて、単 官能性ヒドロキシ物質を使用する時には、その当 量が約250より大きくないことが好ましい。

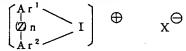
ポリ官能性ヒドロキシル含有物質が使用される 25 時には、硬化組成物に所望される性質に応じて、 これは任意の量で使用できる。例えば、エポキシ ドの当量に対するヒドロキシル含有物質の当量の 比は約0.001/1ないし10/1で異なる。主 としてエポキシ樹脂の可撓化(例えば金属上の保 30 護被覆のために)が望まれる適用に対して、

0.001/1程度の低い比が改良された結果を供 する。エポキシドが主としてポリヒドロキシ含有 フイルム形成性熱可塑性有機物質のための不溶化 剤として供される適用に対して(例えば、印刷版 35 面のための被覆)、エポキシド当量に対するヒド ロキシル当量の比は10/1程度に高い。概して 言えば、ヒドロキシル当量が高くなるにつれて、 この物質は硬化組成物へ一定程度のタフネスと可 撓性を付与することに更に有効である。

所望の時には、ヒドロキシル含有物質の混合物 が使用できる。例えば、二つ又はそれ以上のポリ 官能性ヒドロキシ物質の混合物、ポリ官能性ヒド ロキシ物質と共に一つ又はそれ以上の単官能性ヒ ドロキシ物質を使用できる。

本発明の組成物に無用であるホト開始剤は2種 類、即ち芳香族ヨードニウム錯塩と芳香族スルホ ニウム錯塩である。

芳香族ヨードニウム錯塩は式:



〔式中Ar<sup>1</sup>とAr<sup>2</sup>は4ないし20炭素原子を 有する芳香族基でありそしてフェニル、チェニル、 フラニル及びピラゾリル基からなる群から選択さ れ; 乙は酸素; イオウ; \$=0; Ċ=0; 0=\$ =O;R-NここでRはアリール(フエニルのよ うな6ないし20炭素の)、又はアシル(アセチ かに2以下(例えば1ないし15)の官能性を有 15 ル、ベンゾイル等のような2ないし20炭素の) である: 炭素対炭素結合: 又は R<sub>1</sub> - Ċ - R<sub>2</sub> こと で R1と R2は水素、1ないし4炭素のアルキル基、 及び2ないし4炭素のアルケニル基から選択され る;からなる群から選択され、そしてnはゼロ又 用に対して不適当である硬化組成物を供する傾向 20 は1 であり、そしてしかも $X^-$ はテトラフルオロ ボレート、ヘキサフルオロホスフェート、ヘキサ フルオロアルセネート及びヘキサフルオロアンチ モネートから選択されたハロゲン含有錯陰イオン である〕のものである。

> 芳香族ヨードニウム陽イオンは安定でありかつ 当業者に周知でありそして認められている。例え ば、米国特許 % 3,5 6 5,9 0 6; 3,7 1 2,9 2 0; 3,759,989及び3,763,187;エフ. ベリ ンガー(F. Beringer)等のDiaryliodonium Salts IX, J. Am. Chem. Soc. 81, 342-51(1959)そしてエフ、ベリンガー等の Diaryliodonium Salts XXIII, J. Chem. Soc. 1964、442-51;エフベリンガー 等の Iodonium Salts Containing Heterocyclic Iodine, J.Org. Chem. 30, 1141-8 (1965)を参照せよ。

代表的なAr<sup>1</sup>及びAr<sup>2</sup>基はフェニル、チェニ ル、フラニル及びピラゾリル基から選択された4 ないし20炭素原子を有する芳香族基である。こ 40 れらの芳香族基は選択的に一つ又はそれ以上の縮 合ベンゾ環(例えば、ナフチル等:ベンゾチエニ ル、ジベンゾチエニル;ベンゾフラニル、ジベン ゾフラニル等)を有してもよい。この芳香族基は またエポキシド及びヒドロキシと本質上非反応性

である下記の非塩基性基の一つ又はそれ以上で置 換されてもよい;ハロゲン、ニトロ、N-アリー ルアニリノ基、エステル基(例えばアルコキシカ ルボニル、例えばメトキシカルボニル及びエトキ シカルボニル、フエノキシカルボニル)、スルホ 5 エステル基(例えばアルコキシスルホニル、例え ばメトキシスルホニル及びプトキシスルホニル、 フェノキシスルホニル等)、アミド基(例えばア セトアミド、ブチルアミド、エチルスルホアミド、 等)、カルバミル基(例えばカルバミル、N-ア 10 ルキルカルバミル、N-フエニルカルバミル等)、 スルフアミル基(例えば、スルフアミル、N-ア ルキルスルフアミル、N,N-ジアルキルスルフ アミル、N-フェニルースルフアミル等)、アル コキシ基(例えばメトキシ、エトキシ、ブトキシ 15 等)、アリール基(例えばフエニル)、アルキル 基(例えばメチル、エチル、ブチル等)、アリー ルオキシ基(例えばフエノキシ)、アルキルスル ホニル ( 例えば、メチルスルホニル、エチルスル ホニル等)、アリールスルホニル基(例えばフエ 20 ニルスルホニル基)、ペルフルオロアルキル基 ( 例えばトリフルオロメチル、ペルフルオロエチ ル等)、及びペルフルオロアルキルスルホニル基 ( 例えばトリフルオロメチルスルホニル、ペルフ ルオロブチルスルホニル等)。

芳香族ヨードニウム錯塩ホト開始剤の好適な例 は下記のものを含む:

ジフエニルヨードニウムテ トラフルオロボレート ジ(4-メチルフエニル)ヨードニウムテトラ フルオロボレート

フエニルー4ーメチルフエニルヨードニウムテ トラフルオロボレート

- ジ(4-ヘプチルフエニル)ヨードニウムテト ラフルオロボレート
- フルオロホスフエート
- ジ(4-クロロフエニル)ヨードニウムヘキサ フルオロホスフェート
- ジ(ナフチル)ヨードニウムテトラフルオロボ
- ジ(4-トリフルオロメチルフエニル)ョード ニウムテトラフルオロボレート
- ジフェニルヨー ドニウムヘキサフルオロホスフ エート

ジ(4-メチルフエニル)ヨードニウムヘキサ フルオロホスフエート

- ジフエニルヨードニウムヘキサフルオロアルセ
- ジ(4-フエノキシフエニル)ョードニウムテ トラフルオロボレート
- フェニルー2ーチェニルヨードニウムヘキサフ ルオロホスフエート
- 3,5ージメチルピラゾリルー4ーフエニルヨ ードニウムヘキサフルオロホスフェート
- ジフェニルョードニウムヘキサフルオロアンチ モネート
- 2,2'ージフェニルョードニウムテトラフルオ ロボレート
- ジ(2,4ージクロロフエニル)ヨードニウム ヘキサフルオロホスフエート
- ジ(4-メトキシフエニル)ヨードニウムヘキ サフルオロホスフエート
- ジ(4-プロモフエニル)ヨードニウムヘキサ フルオロホスフェート
- ジ(3-カルボキシフエニル)ヨードニウムへ キサフルオロホスフエート
- ジ(3-メトキシカルボニルフエニル)ヨード ニウムヘキサフルオロホスフエート
- ジ(3-メトキシスルホニルフエニル)ヨード ニウムヘキサフルオロホスフエート
  - ジ(4ーアセトアミドフエニル)ヨードニウム ヘキサフルオロホスフエート
  - ジ(2ーベンゾチエニル)ヨードニウムヘキサ フルオロホスフエート

本発明の組成物に使用に適している芳香族ョー ドニウム錯塩の中で好適な塩はジアリールヨード ニウムヘキサフルオロホスフエート及びジアリー ルヨードニウムヘキサフルオロアンチモネートで ジ(3-ニトロフエニル)ョードニウムヘキサ 35 ある。一般にこれらの塩は更に熱安定性であり、 よりはやい反応を促進し、そして錯イオンの他の 芳香族ヨードニウム塩より不活性有機溶媒に更に 可溶性であるので、これらが好ましい。

> この芳香族ヨードニウム錯塩はベリンガー等の 40 J.Am. Chem. Soc. 81, 342 (1959) の教示に従つて(例えばジフエニルョードニウム ビサルフエートのような)対応する芳香族ヨード ニウム単純塩の複分解により製造される。かくし て、例えば錯塩ジフエニルヨードニウムテトラフ

25

ルオロボレートは水約30ml中の銀フルオロボレ ート29.28(150ミリモル)、フルオロホウ 酸 2 8 及びリン酸 0.5 8 を含有する水溶液を 6 0 ℃で塩化ジフエニルョードニウム448(139 ミリモル)の溶液へ添加することにより製造され る。沈殿するハロゲン化銀をろ別しそしてとのろ 液を濃縮して再結晶により精製されるジフエニル ョードニウムフルオロボレートを生ずる。

(1)硫酸中の硫酸ョージルと二つの芳香族化合物 のカツプリング、(2)酢酸ー無水酢酸一硫酸中のョ ウ素酸塩と二つの芳香族化合物のカツプリング、 (3)酸の存在でアシル化ヨージンと二つの芳香族化 合物のカツプリングそして(4)酸の存在で別の芳香 族化合物とヨードン化合物、ヨードソジアセテー ト又はヨードオキシ化合物の縮合を含む種々の方 法により前記のベリンガー等に従つてこの芳香族 ョードニウム単純塩が製造される。方法(3)、例え ばベンゼン 5 5.5 ml、無水酢酸 5 0 ml及びヨウ素 酸カリウム 5 3.5 8 のよくかきまぜた混合物へ 5 50 mlの混合物を添加することによつてジフェニ ルヨードニウムビサルフエートが製造される。こ の混合物を0-5℃で更に4時間かきまぜ、そし て48時間室温でかきまぜ、そしてジェチルエー テル300㎖で処理する。濃縮すると、粗ジフエ 25 ニルヨードニウムビサルフエートが沈殿する。所 望に応じて、これは再結晶により精製できる。

本発明の組成物の使用に適した芳香族スルホニ ウム錯塩ホト開始剤は式:

〔式中R1,R2及びR3はこの基の少くとも一 つが芳香族である場合には、同一又は異なつても する芳香族基(例えば置換え及び未置換フエニル、 チエニル、及びフラニル)及び1ないし20炭素 原子を有するアルキル基からなる群から選択でき る)により定義できる。ことで使用される用語の "アルキル"は置換アルキル基(例えば、ハロゲ 40 ン、ヒドロキシ、アルコキシ、アリールのような・ 置換基)を含むことを意味する。好ましくは、R,; R<sub>2</sub>、及びR<sub>3</sub>は各々芳香族である。 Zは酸素; イ オウ:S=0:Ç=0:〇=S=0:R-Nここ

でRはアリール(6ないし20炭素の、例えばフ エニル)又はアシル(2ないし20炭素の、例え ばアセチル、ベンゾイル等)である;炭素対炭素 結合;又はR4-C-R5ここでR4とR5は水素、 1ないし4炭素原子を有するアルキル基、及び2 ないし4炭素原子を有するアルケニル基からなる 群から選択される;からなる群から選択され、そ してnはゼロ又は1であり;そしてX-はテトラ フルオロボレート、ヘキサフルオロホスフエート、 10 ヘキサフルオロアルセネート及びヘキサフルオロ アンチモネートからなる群から選択されたハロゲ ン含有錯陰イオンである。

芳香族スルホニウム塩は公知でありそして当業 者に認められている。例えば、ジーエツチウイー 15 ガンド (G.H.Wiegand) 等のSynthesis and Reactions of Triarylsulfonium Halides. J. Org. Chem. 33, 2671-75 (1968) に記載された工程に従つてトリアリールー置換ス ルホニウム化合物が製造できる。またアルキル置 ℃で 8 時間にわたつて濃硫酸 3 5 ml及び無水酢酸 20 換を有する芳香族スルホニウム塩はケー・オーク ボ(K.Ohkubo)等のJ.Org.Chem.36、 3 1 4 9 - 5 5 ( 1 9 7 1 ) に記載される工程に よつて製造できる。トリアリール置換スルホニウ ム化合物を製造するための好適な方法はここで参 照として挿入される米国特許 62,807,648に 記載され、これからスルホニウム錯塩が作られる。 所望の錯陰イオンの金属又はアンモニウム塩で複 分解によつてハロゲン化物塩のような対応する単 純塩からスルホニウム錯塩が製造できる。

とのスルホニウム錯塩は少くとも一つの、そし て好ましくは三つの芳香族基で置換される。代表 的な基は4ないし20炭素原子を有する芳香族基 であり、そしてフエニル、チェニル及びフラニル 基から選択される。これらの芳香族基は選択的に よく、そしてこの基は4ないし20炭素原子を有 35 一つ又はそれ以上の縮合ベンゾ環(例えばナフチ ル等;ベンゾチエニル、ジベンゾチエニル;ベン ゾフラニル、ジベンゾフラニル等)を有する。こ の芳香族基はまた所望に応じてエポキシド及びヒ ドロキシと本質上非反応性である一つ又はそれ以 上の下記の非塩基性基により置換してもよい;ハ ロゲン、ニトロ、アリール、エステル基(例えば アルコキシカルボニル、例えばメトキシカルボニ ル及びエトキシカルボニル、フエノキシカルボニ ル及びアシルオキシ、例えばアセトキシ及びプロ

ピオニルオキシ)、スルホエステル基(例えばア ルコキシスルホニル、例えばメトキシスルホニル 及びプトキシスルホニル、フエノキシスルホニル 等)、アミド基(例えばアセトアミド、プチルア ミド、エチルスルホンアミド等)、カルバミル基 5 ( 例えばカルバミル、N-アルキルーカルバミル、 N-フエニルカルバミル等)、スルフアミル基 (例えば、スルフアミル、N-アルキルスルフア ミル、N,N-ジアルキルスルフアミル、N-フ エニルスルフアミル等)、アルコキシ基(例えば、10 メトキシ、エトキシ、ブトキシ等)、アリール基 (例えばフエニル)、アルキル基(例えばメチル、 エチル、ブチル等)アリールオキシ基(例えばフ エノキシ)、アルキルスルホニル(例えば、メチ ルスルホニル、エチルスルホニル、等)、アリー 15 ルスルホニル基(例えば、フエニルスルホニル基)、 ペルフルオロアルキル基(例えば、トリフルオロ メチル、ペルフルオロエチル等)、及びペルフル オロアルキルスルホニル基(例えばトリフルオロ メチルスルホニル、プルフルオロブチルスルホニ 20

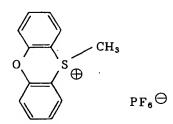
好適な芳香族スルホニウム錯塩ホト開始剤の例 は下記のものを含む:

- トリフエニルスルホニウムテトラフルオロボレ
- メチルジフエニルスルホニウムテトラフルオロ ボレート
- ジメチルフエニルスルホニウムヘキサフルオロ ホスフェート
- トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロホス 30 フェート
- トリフエニルスルホニウムヘキサフルオロアン チモネート
- ジフエニルナフチルスルホニウムへキサフルオ ロアルセネート
- トリトリスルホニウムヘキサフルオロホスフェ ート
- アニシルジフエニルスルホニウムへキサフルオ ロアンチモネート
- 4 ープトキシフェニルジフェニルスルホニウム *40* テトラフルオロボレート
- 4 ークロロフエニルジフエニルスルホニウムへ キサフルオロアンチモネート

16

トリス(4-フエノキシフエニル)スルホニウムヘキサフルオロホスフエート

- ジ(4-エトキンフエニル)メチルスルホニウムへキサフルオロアルセネート
- 4-アセトキシーフエニルジフエニルスルホニ ウムテトラフルオロボレート
- トリス(4ーチオメトキシフエニル)スルホニ ウムヘキサフルオロホスフエート
- ジ (メトキシスルホニルフエニル )メチルスル ホニウムヘキサフルオロアンチモネート
- ジ(メトキシナフチル)メチルスルホニウムテ トラフルオロボレート
- ジ(カルボメトキシフエニル)メチルスルホニ ウムヘキサフルオロホスフエート
- 4 アセトアミドフエニルジフエニルスルホニ ウムテトラフルオロボレート
- ジメチルナフチルスルホニウムへキサフルオロ ホスフエート
- トリフルオロメチルジフエニルスルホニウムテ ・トラフルオロボレート
- メチル ( N ーメチルフエノチアジニル ) スルホ ニウムヘキサフルオロアンチモネート
- フェニルメチルベンジルスルホニウムヘキサフ ルオロホスフェート



(10-メチルフエノキシアシニウムヘキサフ ルオロホスフエート)

(5-メチルチアンセレニウムヘキサフルオロ ホスフェート)

25

$$H_2 C$$
  $S \oplus .$   $PF_6$ 

(10-フェニルチオキサンテニウムヘキサフ ルオロホスフエート)

(10-フエニルー9,9-ジメチルチオキサ ンテニウムヘキサフルオロホスフェート)

$$O = C$$
 $S \oplus$ 
 $BF_4 \ominus$ 

(10-フエニルー9-オキソチオキサンテニ ウムテトラフルオロボレート)

$$O = S \bigoplus_{BF_4} CH_3$$

テトラフルオロボレート)

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 \\
FF_6 \\
\end{array}$$

(5-メチル-10,10-ジオキソチアンス

レニウムヘキサフルオロホスフェート)

本発明の組成物に使用に適している芳香族スル ホニウム錯塩の中で、好適な塩はトリフエニルス ルホニウムヘキサフルオロホスフェートのような トリアリール置換塩である。トリアリール置換塩 はモノ及びジアリール置換塩より更に熱安定性で あるのでこれらが適し、これにより長い貯蔵寿命 を有するワンパートの硬化可能な系を供する。ま た一定の露光で光硬化の速度はトリアリール置換 10 錯塩が使用される時より大きい。トリアリール置 換錯塩はまた染料増感に対して更に受け易い。結 果的に、この錯塩の使用はグラフイツク技術の適 用及び近紫外線と可視光が露出のため使用される 他の適用にずつと更に有用である光重合可能な組 15 成物を生ずる。

本発明の光重合可能な組成物は接着剤、コーキ ング及びシーリング化合物、成形及び鋳造化合物、 ポツテイング及びカプセル化化合物、含浸及び被 覆化合物等として、使用される特定の有機物質及 20 び芳香族スルホニウム錯塩に応じて使用できる。 との光共重合可能な組成物はワンパートのその場 硬化組成物として使用できる。

所望に応じて、この光共重合可能の組成物に約 50容量%までの又はそれ以上の種々の従来の非 25 基本的充塡剤(例えば、シリカ、タルク、ガラス 泡、粘土、粉末金属、例えばアルミニウム、酸化 亜鉛等)粘度調節剤、ゴム、粘着化剤、顔料等を 含有させてもよい。

この光共重合可能な組成物は優れた衝撃抵抗と 30 耐摩耗性、及び金属、プラスチツク、ゴム、ガラ ス、紙、木及びセラミツクスのような堅い、弾性 的かつ可撓性基質へ接着; 殆どの溶剤と化学品に 対する優れた耐性そして高い解像力の像を形成す るその性能により保護コーテイングとグラフイツ (5-メチル-10-オキソチアンスレニウム 35 ク技術の分野で種々の適用に特に適している。こ の用途の中にはケミカルミリングのために酸一及 びアルカリレジスト像、グラビア像、オフセツト 版面、フレキソグラフイツク印刷、スクリーンレ スリトグラフィー、レリーフ印刷版面、ステンシ 40 ルメーキング、印刷回路のためのマイクロ像、情 報蓄積のためマイクロ像、紙、ガラス、金属表面 及び光硬化保護コーテイングの装飾を製造すると とがある。この組成物はまたガラス布等の基質に 含浸するために使用されて熱硬化性液体組成物が 使用に適さない多くの製造及び修理工程に有用で ある貯蔵安定性生成物を得る。

本発明の組成物の光重合は紫外線と可視スペク トル区域以内の波長で活性輻射線を放出する任意 の輻射線源に組成物を露出すると起こる。好適な 5 幅射線源は水銀、キセノン、カーボンアーク及び タングステンフイラメントランプ、太陽光等を含 む。露出は使用される特定の重合可能物質と芳香 族錯塩の量、そして幅射線源及び源からの距離と 硬化されるべき被覆の厚さに応じて、約1秒以下 10 ないし10分又はそれ以上である。この組成物は また電子ビーム照射へ露出により重合できる。概 して言えば、必要な線量は1以下ないし100メ ガラツド又はそれ以上である。電子ビーム硬化の 主要な利点の一つは高度に着色された組成物が活 15 性輻射線へ露出することより早い速度で有効に硬 化できることにある。

この硬化はトリガされた反応であり、即ち芳香 族ョードニウム又はスルホニウム錯塩のデグラデ ーションが一度輻射線源へ露出により開始される 20 と、この硬化反応が進みそして幅射線源が除去さ れた後にも続く。輻射線源へ露出の間又は後で熱 エネルギーの使用は一般に硬化反応を促進し、そ して温度に温和な増加さえも硬化速度を大いに促 進する。

本発明の光重合可能な組成物に有用な芳香族ョ ードニウム錯塩はそれ自体紫外線にのみ感光性で ある。しかしながら、これらはここで参照として 挿入される米国特許 16 3.7 2 9,3 1 3 の教示に従 つて、公知の光分解性有機ハロゲン化合物のため 30 の増感剤によりスペクトルの近紫外及び可視区域 に増感できる。例示の増感剤は下記のカテゴリー 内に見られる:芳香族アミン、及び着色された芳 香族多環式炭化水素。強塩基性アミノ化合物は重 合を遅延するのでこの化合物の使用はあまり望ま 35 しくない。

本発明の光重合可能な組成物に有用な芳香族ス ルホニウム錯塩はそれ自体紫外線にのみ感光性で ある。しかしながら、これらは選択された一群の 増感剤によりスペクトルの近紫外及び可視区域に 40 増感される。有用な増感剤は下記のカテゴリー内 に見られる:

(1) 式:

20

(式中Ar<sup>1</sup>, Ar<sup>2</sup>及びAr<sup>3</sup>は6ないし20 炭素原子を有する芳香族基であり、そして同一 又は異なつてもよい。この芳香族基は所望に応 じてヒドロキシル、アルコキシアシル又はアル キルで置換してもよい。 Zは酸素;イオウ; S = 0 ; C = 0 ; O = S = 0 ; R - N C C C R dアリール(6ないし20炭素の、例えばフエニ ル、ナフチル等)であり;炭素対炭素結合;又 はR<sub>4</sub>-C-R<sub>5</sub>ここでR<sub>4</sub>とR<sub>5</sub>は水素、1ない し4炭素のアルキル基、及び2ないし4炭素の アルケニル基から選択される;からなる群から 選択され、そしてことでnは0又は1である) を有する芳香族第三アミン。

(2) 式

25

$$\begin{array}{c|c}
A & r^{4} \\
\hline
C \\
D \\
A \\
T^{5}
\end{array}$$

$$N - Y - N \longrightarrow \begin{pmatrix}
A & r^{6} \\
C \\
D \\
A \\
T^{7}
\end{matrix}$$

(式中Yはアリーレン及びAr<sup>8</sup>-Z-Ar<sup>9</sup> から選択された2価の基であり、ここで2は芳 香族第三アミンに対して前記に記載した通り; Ar<sup>4</sup>, Ar<sup>5</sup>, Ar<sup>6</sup>, Ar<sup>7</sup>, Ar<sup>8</sup>及びAr<sup>9</sup> は6ないし20炭素原子を有する芳香族基であ りかつ同一又は異なつてもよく;そしてmとn はゼロ又は1である。この芳香族基は所望に応 じてヒドロキシル、アルコキシ、アシル又はア ルキルのような基で置換できる)を有する芳香 族第三ジアミン。

(3) 少くとも三つの縮合ベンゼン環を有しそして エフ・エー・マツトセン (F.A. Matsen)のJ. Chem. Physics 24,602(1956)の方 法により計算されるように、約7.5 ev 以下の イオン化エネルギーを有する芳香族多環式化合 物。

前記の有用な種類内に入る代表的な増感剤は例 えばトリフエニルアミン、2ーエチルー9,10 ージメトキシアントラセン、アントラセン、9ー メチルーアントラセン、ルブレン、ペリレーン及 びテトラフエニルベンジデインを含む。

本発明の組成物に使用できる芳香族ョードニウ ム又はスルホニウム錯塩の量は有機物質(即ちエ ポキシドプラスヒドロキシル含有物質)100重 量部当り約0.1ないし30重量部、そして好まし くは有機物質の100部当り約1ないし10部で ある。所望に応じて、この組成物は更に商業上実 際の被覆組成物へ後の希釈に適している(例えば、 使用される場所で、更にエポキシド又はヒドロキ 5 シル含有物質又は両方を添加することによる)貯 蔵安定性濃縮形で(即ち、錯塩の高いレベルで、・ 例えば10ないし30重量%で)製造できる。

概して言えば、重合の速度は一定の露光又は照 射で錯塩の量が増加するにつれて増大する。また 1 重合の速度はまた光強度又は電子線量が増加する につれて増大する。組成物をより長い波長の輻射 線に対して増感性にするため増感剤が使用される 組成物に対して芳香族錯塩の部当り約0.01ない し1.0 重量部の増感剤が使用できる。

本発明の光共重合可能な組成物は "安全光 "条 件下で、有機物質と芳香族錯塩及び使用される時 には増感剤を単に混合することによつて製造され る。この混合を行なう時に所望に応じて好適な不 活性溶剤が使用できる。好適な溶剤の例はアセト 20 収縮は減少した。 シ、塩化メチレンであり、そしてエポキシド、ヒ ドロキシル含有物質、芳香族錯塩又は増感剤と認 めうるほどに反応しない任意の溶剤を含む。重合 されるべき液体有機物質は重合されるべき他の液 体又は固体有機物質のため溶剤として使用できる。25 て重量損失を測定した。実施例1,2及び3から 材料の溶液を得ることを補助するため、そして被 覆の目的のために組成物へ好適な粘度を供すると とを補助するため不活性溶剤が使用できる。温和 な加熱と共に又はなしで有機物質に芳香族錯塩と 増感剤を単に溶解させることにより無溶剤組成物 30 が製造できる。

本発明を例示するのに役立つ下記の実施例では、 特記しない限りすべての部は重量部であり、そし てすべての百分率は重量百分率である。

#### 実施例 1-5

ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロホスフ エート0.5部と2一エチルー9,10ージメトキ シアントラセン 0.0 5 部を含有するエポキシ樹脂 (エポキシ当量185)10部へ、下記の表に示 すように、別々の例で種々の量のポリオキシテト 40 実施例 6 ラメチレングリコーク("ポリメグ(Polymeg) 650 "(商品名)、ヒドロキシル当量325) を添加した。優れた安全性を有する生成溶液を厚 さ100ミクロンの光共重合可能な被覆を残すよ

うにポリエステルフイルム(75ミクロン)上に ナイフ被覆した。これらの試料を7インチ(17.5 cm)の距離でゼネラルエレクトリツクH3T7 500ワツト水銀蒸気灯に各々露出した。硬化す るのに各試料の被覆のために必要とされる時間を 第Ⅰ表に記録する。硬化後、各被覆を自立性フイ ルムの形でポリエステル基質からストリツプでき た。

篤 **I** 表

10	実施例 <i>K</i> 6	"ポリメグ650"(商品名) (部)	露出時間 (秒)
	1	2	2 0
	2	4	3 5
	3	6	4 0
15	4	8	4 5
	5	1 0	5 0

実施例1-5の各々で硬化した被覆(即ちフイ ルム)は透明であり、そしてフイルムの可撓性は 実施例1から5へ連続して増加し、一方フイルム

各フイルムの秤量した試料をアセトンで満たし たジャーに入れ、そして周期的にふりまぜながら 7日間放電した。次に試料をジャーから取出し、 2 4 時間空気中で乾燥し、そして次に再び秤量し フイルムの試料は殆ど膨潤なしにかつ重量損失な しに優れた耐密剤性を示した。実施例4及び5か らの試料は各々全重量の3.7%及び7.5%を失つ た。すべてのヒドロキシル含有物質は実施例1 , 2及び3においてエポキシドと反応し、91%と 85%が実施例4及び5で各々エポキシドと反応

物理的測定により実施例2のフイルムは6500 p.s.i の引張強さと破壊時で5%伸びを示し、一 方実施例3のフイルムは1060 p.s.i. の引張 強さと53%伸びを有した。これは広範囲の物理 的性質がエポキシドとヒドロキシル含有物質の相 対量を変えることによつて本発明の組成物から得 られることを示す。

下記の成分を使用して低粘度(1,3ストーク ス)、100%固体光共重合可能な組成物を製造 した:

	部
エポキシ樹脂(当量137)	5
ポリオキシエチレングリコール ( 当量 2 0 0 )	2
ジフエニルヨードニウムヘキサフル オロホスフエート	0. 2 5
2-エチルー9,10-ジメトキシ アントラセン	0.025

50℃で30分間加熱しかつかきまぜながらとの成分を混合した。次に生成する貯蔵安定性組成物を75ミクロンの厚さで被覆しそして5インチ(12.7㎝)の距離で275ワツトゼネラルエルクトリツク太陽灯に35秒間露出した。透明な自立性、丈夫なフイルムが得られた。

#### 実施例 7

6時間下記の成分をボールミルすることによつ て着色された、100%固体の、流動性の、光共 重合可能な、貯蔵安定性組成物を製造した:

	q <sub>E</sub>
エポキシ樹脂(当量137)	6
ポリオキシエチレングリコール (当量200)	2
(当重200)	3
酸化亜鉛	<sub>.</sub> 9

ジフエニルヨードニウムへキサフル オロホスフエート 0.25 2ーエチルー9,10ージメトキシ アントラセン 0.025

との組成物の55ミクロン厚さのフイルムを5インチ(12.7cm)の距離で275ワツトゼネラルエレクトリツク太陽灯へ60秒間露出により可撓性、自立性白色フイルムへ硬化した。

実施例 8-20

10 別々の実施例で種々のエポキシド、ヒドロキシル含有物質及び錯塩ホト開始剤を使用して幾つかの光共重合可能な貯蔵安定性組成物を製造した。温和に加熱しながら成分を共に混合することによって組成物を製造した。使用した成分、及び露光15 条件を下記の第Ⅱ表に示す。この太陽灯は5インチ(12.7㎝)の距離で使用した275ワツトゼネラルエレクトリツク太陽灯であり、そしてH3T7は7インチ(17.5㎝)の距離で使用したゼネラルエレクトリツク500ワツト水銀蒸気灯であつた。各実施例において、十分に硬化された、透明な、丈夫な、可撓性フイルムが得られた。

	ブンプ	太陽灯	"	H3T7	" .	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	(金)	8 0	3 5	4 0	4 5	2 4 0	3 5	4 5	0 6	180	3 0 0	3 0 0	0 0 9	1 2 0
	被覆厚さ (ミクロン)	150	5 0	7 5	4 3	5 0	0 6	100	5 0	5 0	0 6	5 0	5 0	9 0
	品	0.025	"	"	. "	*	"	"			0.025	"		0.0 2
•	増成剤型、水	DMA *	"	"	"	"	"	"	無っ	無つ	DMA	"	無。	トリフェール
1 表	祖	0.25	"	"	"	F6 "	"	"	0.20	"	0.25	"	0.025	0.20
	超式	$\phi_2$ IPF <sub>6</sub>	"	"	#	$\phi_2 \text{ SCH}_3 \text{ PF}_0$	φ2 IPF6	"	$\phi_3 \text{ SPF}_6$	$\phi_2 \text{ ISbF}_6$	$\phi_{3} \text{ SPF}_{6}$	"	$\phi_2 \text{ IPF}_6$	"
無	物質 重量部	က	က		0.5	2	က	2	က	က	-	-	2	2
	ヒドロキシル含有物質 型 式 重量	"PPG-400"	"PEG-1000"	"PPG-400"	ジエチレングリコール	"PEG-400"	"ポリメグ1000"	"ポリメグ2000"	"PPG-400"	"	"ポリメグ650"	"	"PEG-400"	"PEP-550"
	エポキシド (5重量部)	"ERL-4221"	"	"エポン828"	" DER-331 "	"ERL-4221 "	"DER-331"	. "	"ERL-4221"	"	"エポン1004"	"エポン1010"	"ERL-4221"	"DER-331"
	実施例派	œ	6	1 0	1 1	12.	1 3	1 4	1 5	1 6	1.7	1 8	1 9	2.0

K2ーエチルー 0 - 1 0 ージメトホシアントゥセン

#### 実施例 21

示した量で下記の成分を室温でかきまぜること によって貯蔵安定性光共重合可能な組成物を製造 した:

ヒドロキシル含有物質("クリセル (Kluce!)E"(商品名)第二水酸基 を含有するヒドロキシルプロピル 化セルロース重合体の15%メタ ノール溶液)	1 6
エポキシ樹脂 (" ERLー 4 2 2 1" (商品名) 〕	1. 4
ジフエニルヨードニウムヘキサフル オロホスフエート	0.36
2-エチルー9,10-ジメトキシ アントラセン	0. 1 1

性厚さでとの生成する組成物を陽極処理アルミニ ウムシート上に被覆した。乾燥した試料を5イン チ(12.7㎝)の距離で275ワツトゼネラルエ レクトリツク太陽灯に6.0秒間ょ,写真用ステツ プタブレツトを通して露出した。次に露出した試 20 料を流水下に保つて非光不溶化区域を溶解する。 ステツプタブレツトの7ステツプアルミニウムシ ート上に残つた。硬化した被覆はインキ受容性で あり、かつリトグラフィー印刷版面として有用で あつた。

#### 実施例 22

下記の成分を共にかきまぜることによつて貯蔵 安定性光共重合可能な組成物を製造した:

	部
ヒドロキシル含有物質 ("ブチバールBー73"(商品名) の10%メタノール溶液〕	2 5
nープタノール	2
エポキシ樹脂 ( "ERL-4221 " )	1
ジフエニルヨードニウムヘキサフル オロホスフエート	0. 4
2 -エチルー9 , 1 0 -ジメトキシ アントラセン	0.12

との"ブチバールB-73"(商品名)は 50,000-80,000の分子量、17.5-21.0 %のヒドロキシル含量、0-2.5%のアセテート 含量、及び80%のブチラール含量を有する市販 のポリビニルブチラール樹脂である。

この組成物をポリエステルのフイルム (厚さ 75ミクロン)の上に50ミクロンの湿性厚さに ナイフ被覆し、そして1時間風乾した。この試料 を実施例21の方法に従つて15秒間露出しそし て灰にメタノールに浸漬した。現像後ステツプタ ブレツトの4ステツプが残つた。

# 5 実施例 23

実施例22におけるように貯蔵安定性光共重合 可能組成物を製造したが、ただし " ブチバールB -73(商品名)を"ブチバールB-98"(商 品名)(30,000-34,000の分子量、18 10 -20%のヒドロキシル含量、0-2.5%のアセ テート含量、及び80%のブチラール含量を有す る市販のポリビニルブチラール樹脂)で置き換え た。との組成物を被覆し、乾燥し、そして20秒 間露出し、次に実施例22の工程に従つて現像し 針金を巻いた棒を使用して約60ミクロンの湿 I5 た。現像後ステツプタブレツトの5ステツプが残 つた。

#### 実施例 24-26

" アルコールソリユーブルブチレート " ( 商品 名) (平均して47.2%のブチリル、1.6%のア セチル及び 4.5 3 %のヒドロキシル含量を有する 市販のセルロースアセテートブチレートエステル) の10%溶液(メタノール中)25部にジフエニ ルョードニウムヘキサフルオロホスフエート 0.4 部及び2-エチルー9、10-ジメトキシアント 25 ラセン 0.1 2 部を溶解することによつてマスター 溶液を製造した。別々の実施例で、マスター溶液 5 部を種々のエポキシドと混合し、生成する貯蔵 安定性組成物を陽極処理アルミニウムシート上に 被覆し、そして次に実施例21の工程に従つて現 30 像したが、ただしこの露出したシートを水の代り にメタノールで現像した。使用したエポキシド、 露出時間、及び不溶性のままであるステツプタブ レツトのステツプの数を下記の第Ⅱ表に示す。

## 第 1 表

<i>35</i>	実施例 %	エポキシ 部		露出(秒)	不溶性ステップ
	2 4	" DER-33	1 " 0.3	3.0	4
	2 5	" ERL-4 2	2 1 " 0.3	6 0	3
	2 6	" DER-XD	7818 ° 0.1	6 0	7
40	" D I	ER-XD78	318"(産	品名	) は3400
	cps の料	上度及び165	のエポキシ	/ ド当	量を有する
	芳香族么	ブリシジルエー	-テル型のコ	レポキ	シ樹脂であ
	る:ダウ	ケミカル社が	nら市販。		
	実施例	2 7			

下記の成分を共にかきまぜることによって貯蔵 安定性光共重合可能な組成物を製造した:

	部	
ヒドロキシル含有物質 ("プチバールB-76"の10%		
アセトン密液 )	1 2.5	•
пーブタノール	1	
エポキシ樹脂( "ERL-4221" )	0. 4	
トリフエニルスルホニウムヘキサ		
フルオロホスフエート	0. 2	
トリフエニルアミン	0.06	1
" ブチバールBー76 " は50,000 -	-80,000	
0分子量、17.5~21%のヒドロキシ	ノル含量、	

の分子量、17.5-21%のヒドロキシル含量、0-2.5%のアセテート含量、及び80%のプチラール含量を有する市販のポリビニルブチラール 樹脂である。

この組成物をポリエステルのフイルム(75ミクロン)上に50ミクロンの湿性厚さにナイフ被覆し、そして1時間風乾した。次に実施例21の工程と装置を使用して、2分間275ワツト太陽

30

灯へこの試料をステツプタブレットを通して露出し、その後に試料にメタノールを噴霧した。被覆の不溶化により3固体ステツプと4部分ステツプが残つた。

# 5 実施例 28-43

別々の実施例では幾つかの貯蔵安定性光共重合可能な組成物を製造し、ここでは光に露出するとエポキシドが種々の型式のヒドロキシル含有末端化ポリカプロラクトン及び脂肪族ポリオールと共10に共重合する。これらの種々の組成物を下記の第Ⅳ表に記載する。各実施例では成分を温和に加熱しながら共にかきまぜた。露出すると(第Ⅱ表に表示した条件下で)組成物は透明な、丈夫な、可撓性フイルムへ硬化した。太陽灯は5インチ

15 (12.7 cm)の距離で使用した275ワツトゼネラルエレクトリツク太陽灯でありそしてH3Tでは7インチ(17.5 cm)の距離で使用したゼネラルエレクトリツク500ワツト水銀蒸気灯であった。

. 737.

ا ہ	~				کے							•				
ランプ	H3T7	"	"	,#.	(赤陽紅	( ) ( )	"	"	H3T7	"	"	*	*	*	*	*
(金) (金)	2 4 0	2 5	0 6	120	9	0 9	5 5	3 5	0 6	"	*	*	*	*	4 5	2 0
被覆厚さ (ミクロン)	5 0	06.	7 0	∞ ∞	6 4	2 0	7 5	7 5	6 4	2 0	#	#	"	#	0 ਲ	5 0
品	0.0 2 5	"	"	"	"	"	"	*	"						0.0 2	=
増殷剤型、式	DMA **	"	. "	"	"	"	"	"	"	無っ	"	. "	"	"	デトラフェニルーへンジジン	2-クロロチオキ サントン
始	0.25	"	"	"	"	"	"	"	"	. #	"	,,,	, ,	"	0.20	"
型 式 臨 塩	$\phi_2 \text{ SCH}_3 \text{ PF}_6$	$\phi_{2}$ . I P F $_{8}$	"	$\phi_3  \mathrm{SPF}_6$	$\phi_2 \text{ IPF}_6$	"	"	".	"	\$ SSbF6	$\phi_2 \text{ IBF}_4$	$(CH_3 \phi)_2 IBF_6$	$(CH_b \phi)_s SPF_b$	$\phi_2  { m IAsF_6}$	$\phi_{s}  \mathrm{SPF}_{6}$	$\phi_2 \ \mathrm{IPF}_6$
物質 重量部	73	က	2	7	4	က	က	က	2	4	"	"	"	"	63	
ヒドロキシル合有物質 型 式 重量	"PCP-0300"	"、ペラプレンクスUー148"	"マルトロンR-68"	"マルトロンRー1 4 "	"PCP-0300"	"PCP-0210"	"マルトロンR-68"	"、ペラプレックスリー148"	"PCP-0230"	"PCP-0300"	"	" "	"	" "	エトキシエタノール	1,3一プロペジオール
エポキシド (5種量部)	"ERL-4221"	" DEN-4 3 9 "	" DER-3 3 1 "	"ERL-4221"	"	"	"	"	"	"	."	"	. "	"	"エポン828"	"ERL-4221"
実施例為	2 8	2 9	3 0	3 1**	3 5	3 3*	3.4	3 5×××	3 6*	3.7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	<b>4</b> .

\*添加したアセトン1部 \*\*\*700 psiの引張強さ;伸び50% \*\*添加したアセトン3部 \*\*\*\*2ーエチルー9,10ージメトキシアントラセン

### 実施例 44

下記の成分を共化かきまぜることによつて貯蔵 安定性光共重合可能な組成物を製造した:

	部
エポキシ樹脂( "DER-331")	5
ヒドロキシル含有物質 ( " Pep-550" )	2
ジフエニルヨードニウムヘキサフル	
オロホスフエート	0. 2
トリフエニルアミン	0.02

この組成物を厚さ50ミクロンに被覆し、そし 10 て 7 インチ ( 1 7.5 cm ) の距離でゼネラルエレク トリツクH3T7500ワツト水銀蒸気灯へ5分 間露出し、そしてこれは透明な、丈夫な、可撓性 フイルムに硬化した。

#### 実施例 45

下記の成分を共にかきまぜることによつて貯蔵 安定性光共重合可能な組成物を製造した:

	部
エポキシ樹脂("ERL-4221")	5
ヒドロキシル含有物質( "Pep-550")	1. 5
ジフエニルヨードニウムヘキサフル	
オロホスフエート	0. 2
トリフエニルアミン	0.02

この組成物を厚さ50ミクロンに被覆しそして は透明な、丈夫な、可撓性フィルムに硬化した。 実施例 46-48.

下記の第V表に列挙した成分を使用して貯蔵安 定性光共重合可能な組成物を製造した:

実施例 1/6	4 6	4 7	4 8
"ERL-4 2 2 1 "	6 1.5 6	6 1.5 6	61.56
ピスフエノールAのジグリ シジルエーテル	1 8.9 4	1 8.9 4	1 8.9 4
1 , 4ーブタンジオールの ジグリシジルエーテル	3.8 0	3.80	3.80
ジフエニルヨードニウムヘキ サフルオロホスフェート	1.2	1.2	1.2
トリプロピレングリコール	1 4.2	-	-
トリプロピレングリコール モノメチルエーテル	_	1 4.2	_
ガージナー衝撃試験	70	6 5	3 0
殺菌後接着	100%	100%	80%

飲料カンの製造に使用される従来のアルミニウ ムシート(7.5×20cm×0.6mm)のパネル上に ( 針金を巻いた棒を使用して ) 各々の組成物を別

別に被覆し、そして次にランプの焦点でかつ160 フイート/分(50m/分)の速度で二つの200 ワツト/インチ紫外線ランプの下で通過させた。 被覆されたパネル上に反射された光は約2.5㎝幅 5 であつた。露出後、この被覆は不粘着性であり、 そして周辺温度で数秒内に十分に硬化した。所望 に応じて、露光前に基質を僅かに予熱する(例え ば、50-60℃)ととによつて硬化時間が短縮 **される。** 

硬化フイルムは優れた耐熱性を示す(即ち、9 分間175℃で焼成後、黄色化又は他の悪影響は 示されなかつた)。

ガージナー (Gardiner)逆衝撃試験 (ASTMD -2794-69)により硬化フイルムのタフネ 15 スを測定した。標準試験は鋼球が硬化被覆の一体 性を破壊することなしに硬化被覆パネルの反対側 (即ち未被覆)上に減下できる最大の高さ(イン チ)を測定する。結果をインチーポンド(即ち鋼 球の重量×インチで最大の高さ)で報告する。

硬化した被覆に大きなXを切ること、20分間 72℃で水に切れ目をつけたパネルを浸漬すると と、このパネルを乾燥すること、Xの上に感圧性、 テープ(3 M社から市販の"スコツチ"(商品名) セロフアンテープル610)のストリップを固着 実施例44の条件下で1分間露出し、そしてこれ 25 すること、パネルから90°の角度でテープを迅 速に取外すこと、そしてパネルに接着したままで ある被覆のフラクションを評価することによつて パネルに対する硬化被覆の接着を評価した。

> 実施例46と47の被覆したパネル試料は被覆 30 の一体性を破壊することなしにそれ自体が曲げら れ、一方実施例48のパネル上の被覆の一体性は 破壊された。

#### 実施例 49-50

示した重量部で下記の成分を含む二つの溶液を 35 製造した:

	成	分		実施例 4_9	実施例 5_0
	エポキシ樹脂 " ERL-4221 "			5	5
40	1 , 2ープロパンジオール			2	_
	3 ークロ ジオー	ロー 1 -ル	, 2 ープロパン	_	2
	φ I + P	F <sub>6</sub> -		0. 2	0. 2
	アントラ	セン		0.02	0.02

との二つの溶液をポリエステルフイルムの別の

35°

試料上に各々2ミル(50ミクロン)の湿性フイルム厚さにナイフ被覆した。各試料を0.75インチの距離で100キロボルト及び2.5ミリアンペア出力の電子ビーム装置へ露出した。4.5メガラ

ツド線量は実施例50の試料を完全に硬化しかつ 実施例49へ不粘着性表面硬化を付与するのに十 分であつた。14メガラツド線量は実施例49の 被覆を完全に硬化した。

36

**- 96** -